

# PFAS フリーネガ型 ArF 液浸フォトレジスト

## 技術・製品の概要説明

ニュースリリース 2025年7月15日

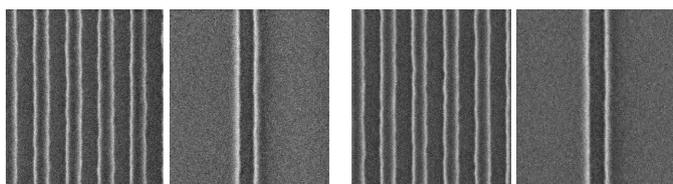
### 先端半導体製造プロセスに用いられる環境配慮型の材料 PFAS フリー ネガ型 ArF 液浸レジスト 新開発

先端半導体の国際研究機関imecと、金属配線工程での高い歩留まりを実証

- ・環境や生態系への影響が懸念される有機フッ素化合物 PFAS を一切使わないネガ型 ArF 液浸露光向けフォトレジスト（トップコートフリー）を開発。
- ・IMEC と協働し、28nm 世代での性能を実証 (Gen.1)。

従来レジスト (PFAS) **POR**

PFASフリー新規レジスト **New**



CD 41nm/Pitch 90nm, CD 41nm/Isolated trench.

imec

#### PFASフリー ArF液浸 NTD レジスト性能

- ・液浸コンパチビリティ 😊
- ・リソグラフィ性能 😊
- ・電気特性 😊

## ロードマップ

プラットフォーム	開発フェーズ	2024	2025	2026	2027	2028+
ArF/ArFi	材料設計 製品開発	コンソーシアム協働		Gen.1	Gen.2	

## パートナーシップ



- ✓ レジストメーカー
- ✓ 原料メーカー



- ✓ デバイスメーカー
- ✓ レジストメーカー
- ✓ 装置メーカー



- ✓ デバイスメーカー
- ✓ レジストメーカー
- ✓ 装置メーカー

環境負荷低減のためのPFASフリー製品の開発、置き換えには、お客様、パートナー企業様の御協力が重要です。